



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D237985 S

(45)公告日：中華民國 114 (2025) 年 05 月 01 日

(21)申請案號：111300791D01

(22)申請日：中華民國 111 (2022) 年 02 月 17 日

(51)LOC.(13)Cl.：15-99

(71)申請人：美商應用材料股份有限公司 (美國) APPLIED MATERIALS, INC. (US)

美國

(72)設計人：萊克 馬丁李 RIKER, MARTIN LEE (US)；張 富宏 ZHANG, FUHONG (US)；

仲蘭蘭 ZHONG, LANLAN (CN)；卡拉瑟帕蘭比爾 奇索庫瑪

KALATHIPARAMBIL, KISHOR KUMAR (IN)

(74)代理人：李世章；彭國洋

(56)參考文獻：

TW D200242

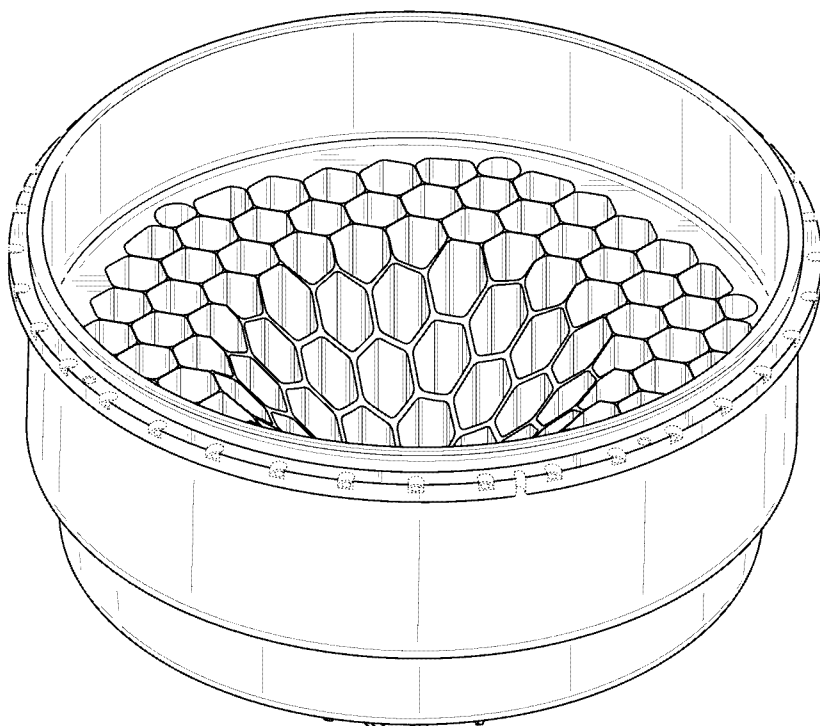
審查人員：高韻萍

圖式數：9 共 10 頁

(54)名稱

用於物理氣相沉積 (PVD) 腔室中的準直器

代表圖：



立體圖



D237985

【衍生設計說明書】公告本

【中文設計名稱】用於物理氣相沉積（PVD）腔室中的準直器

【英文設計名稱】COLLIMATOR FOR USE IN A PHYSICAL VAPOR
DEPOSITION (PVD) CHAMBER

【物品用途】

【0001】 本設計所請求係用於物理氣相沉積（PVD）腔室中的準直器。

【設計說明】

【0002】 圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分。

【0003】 本衍生設計案與原設計（第111300791號申請案）案差異在於，本衍生設計之螺孔和凹槽係以虛線表示（即不主張設計之部分）。

【衍生設計圖式】
(指定代表圖)

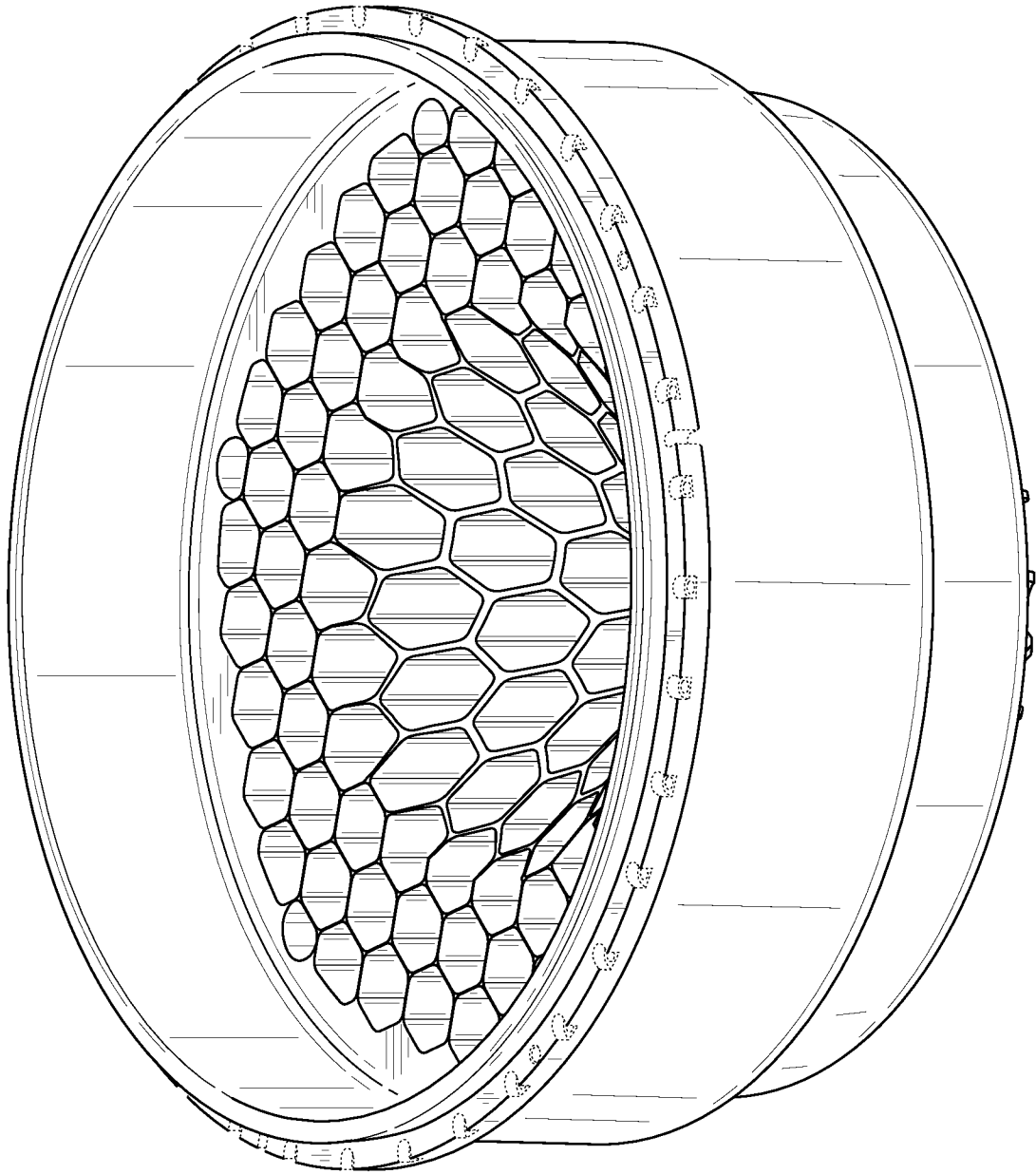
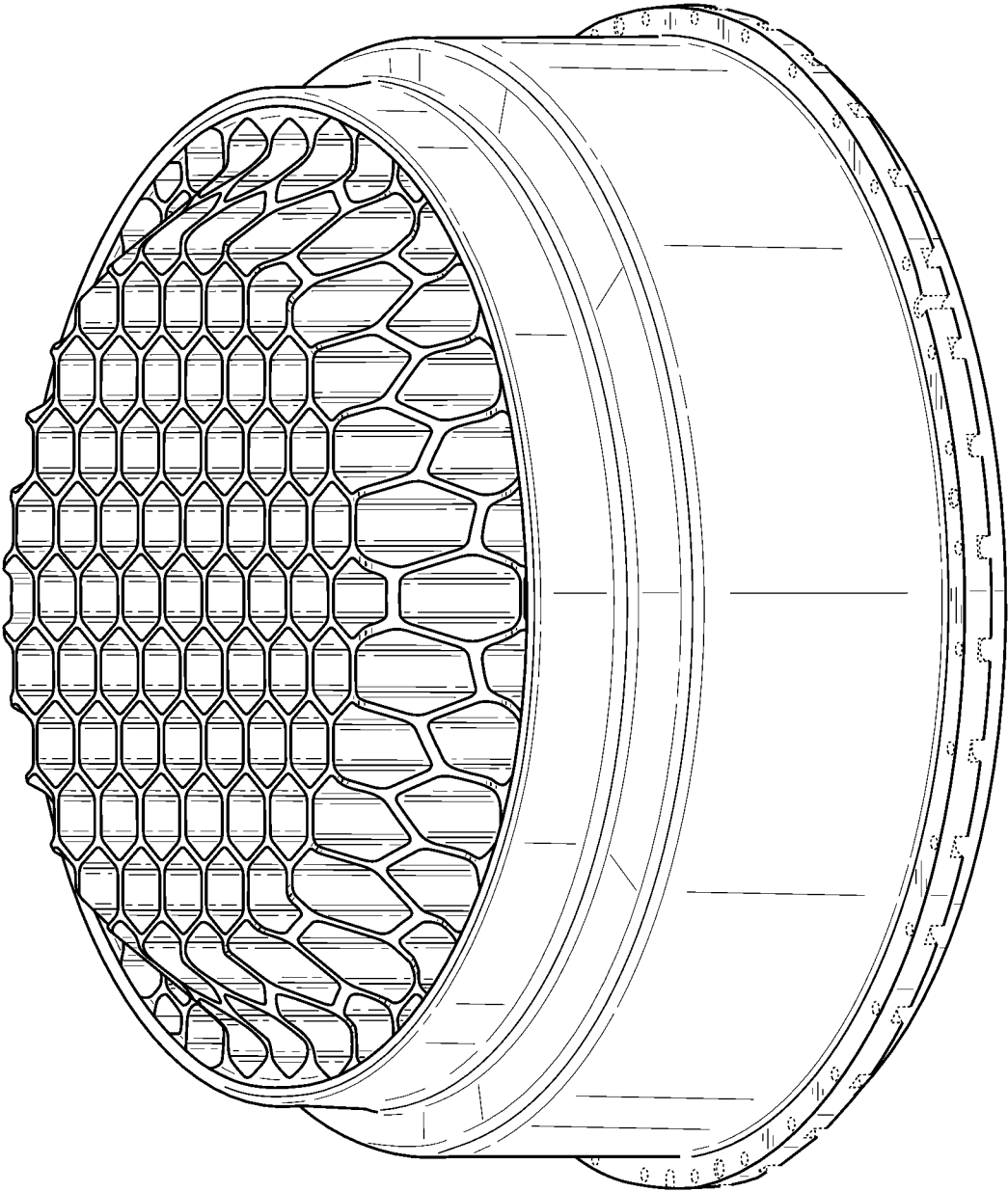
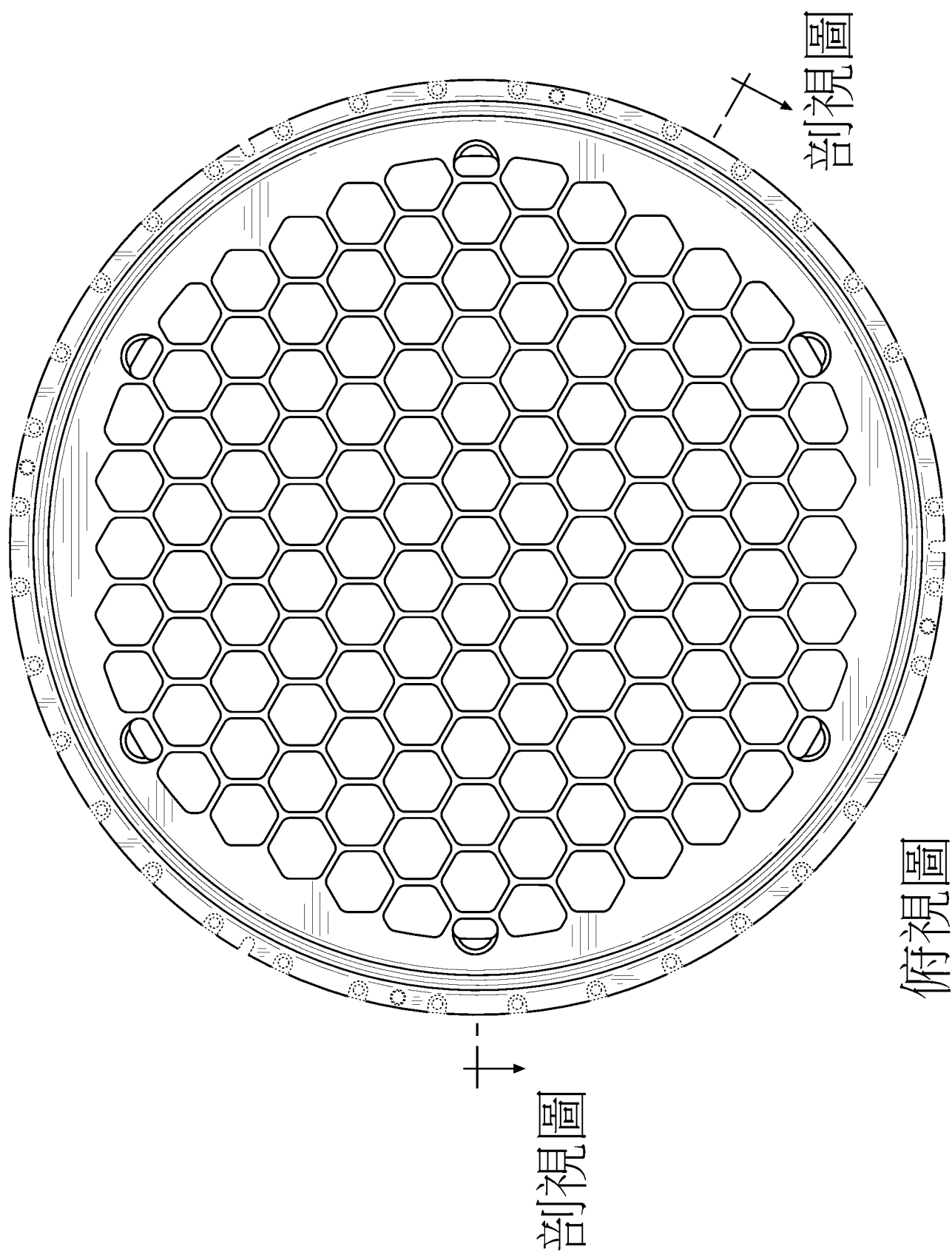


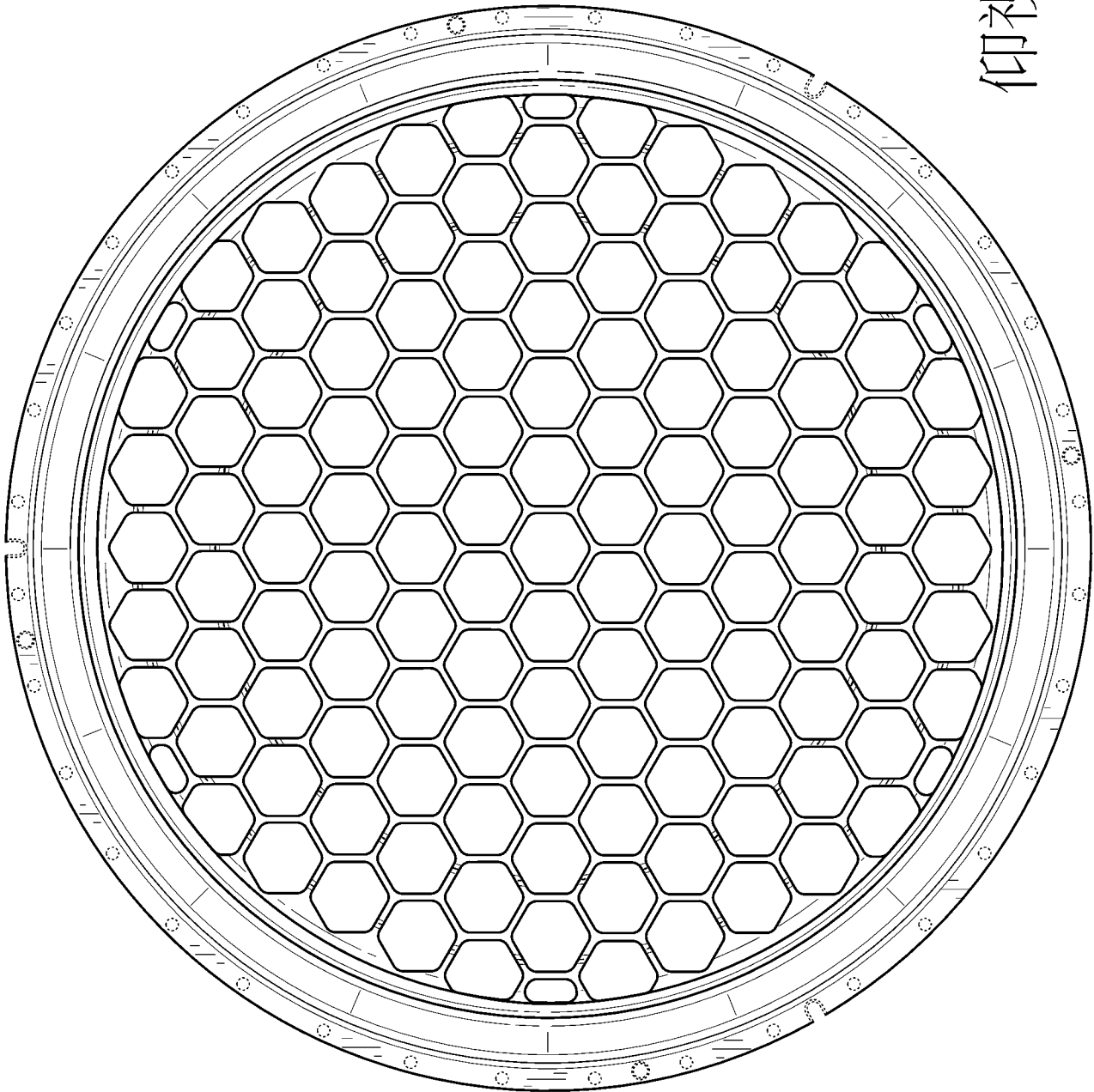
圖
立
體

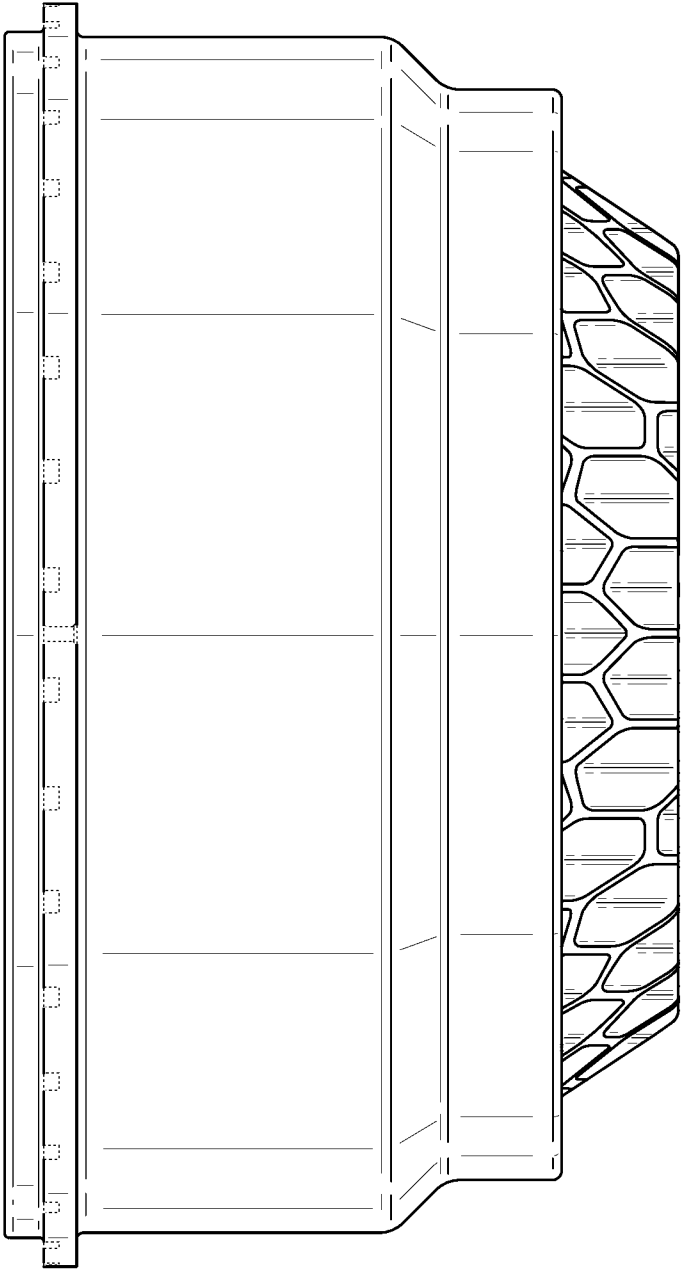


另一立體圖

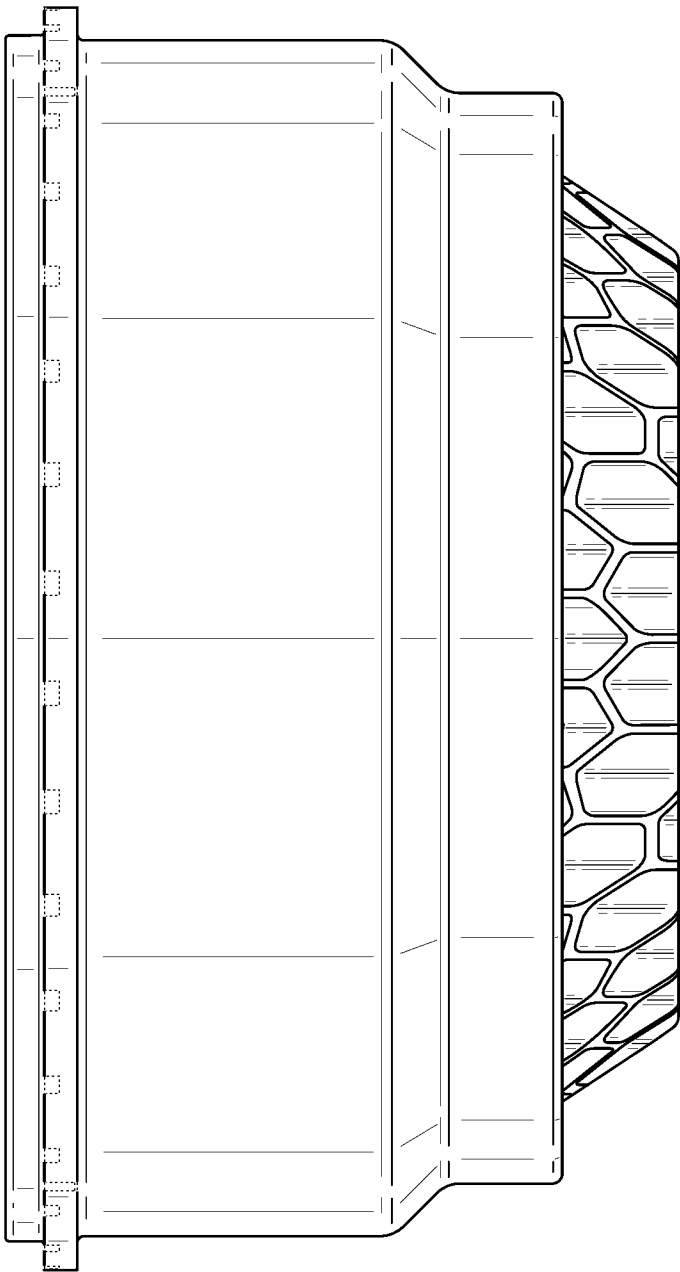


仰視圖

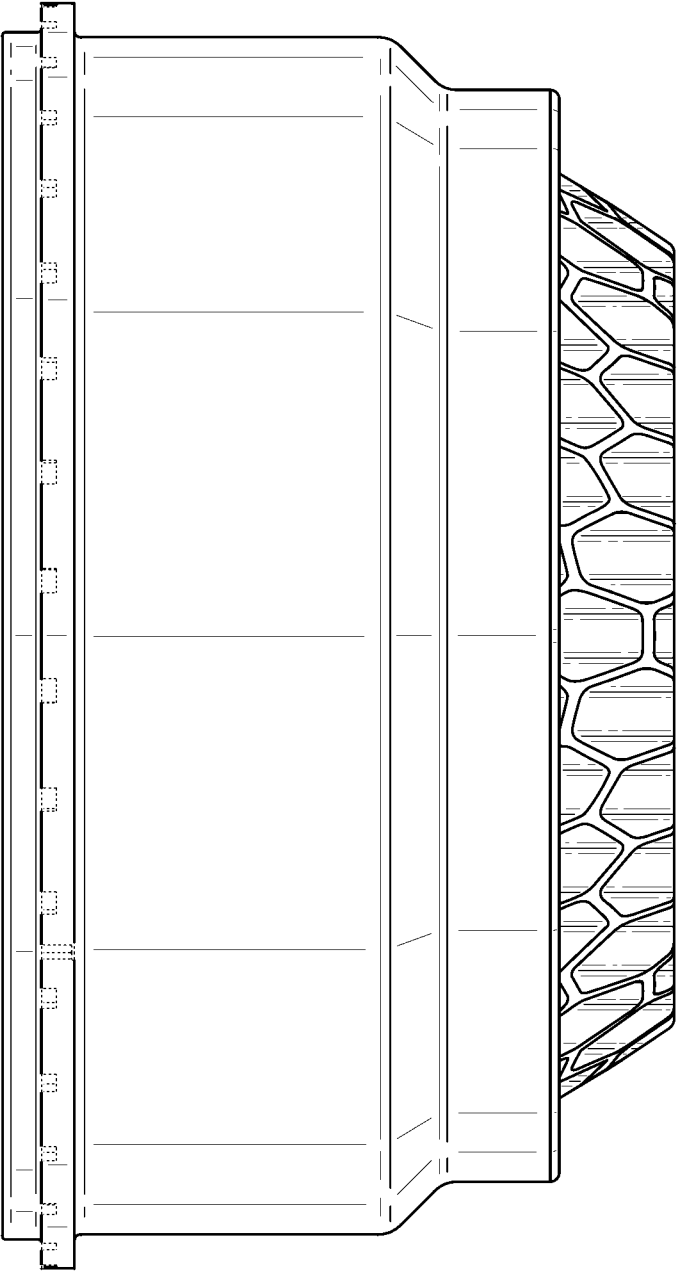




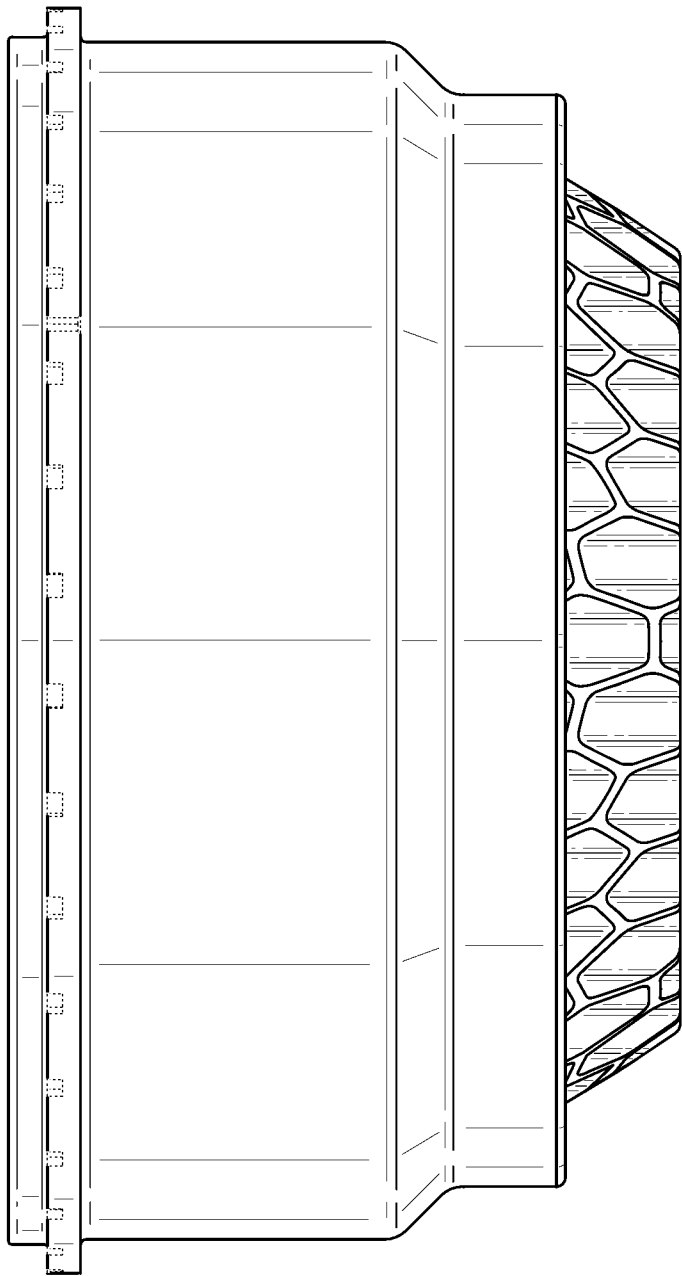
前視圖



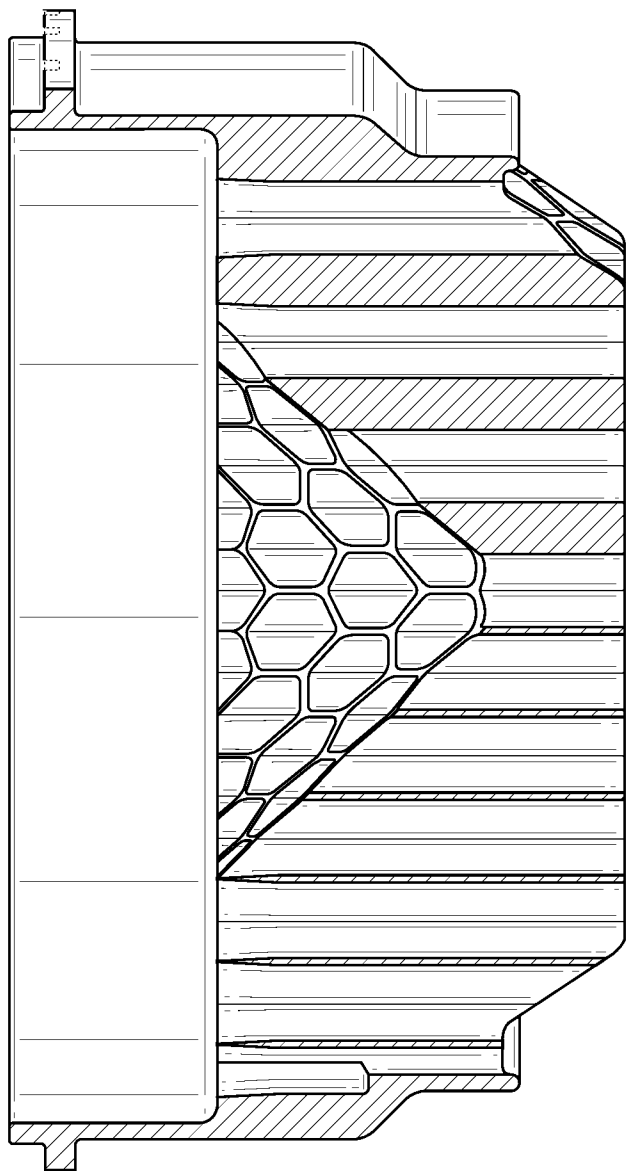
後視圖



左側視圖



右側視圖



沿俯視圖 所示連線之剖視圖